

WHAT IS CLAIMED IS:

1. エレクトロルミネッセント素子を構成する発光層を印刷方式で成膜し、前記発光層を形成するための発光層形成用塗工液の粘度が、0.5 cP以上500 cP以下であることを特徴とするエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

2. 前記印刷方式が、凹版を用いた印刷方式であることを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

3. 前記凹版の溝またはセルの深さが、500オングストローム～1mmの範囲内であることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

4. 前記凹版の発光層形成領域が複数のセルに分割されて形成されていることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

5. 印刷版上の溝またはセルの集団の全面積が、基材上に形成される発光層の面積より小さく形成されていることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

6. 前記印刷方式が、印刷版から基材に発光層形成用塗工液を直接印刷する方式、もしくは印刷版から転写体に発光層形成用塗工液を転写させ、転写体上の発光層形成用塗工液を基材上に印刷する方式のいずれかの印刷方式であることを特徴とする請求項1に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

7. 前記印刷方式が、印刷版から基材に発光層形成用塗工液を直接印刷する方式、もしくは印刷版から転写体に発光層形成用塗工液を転写させ、転写体上の発光層形成用塗工液を基材上に印刷する方式のいずれかの印刷方式であることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

8. 前記印刷方式で用いる印刷版、転写体、基材および圧胴の少なくとも1つが、弾性体であることを特徴とする請求項1に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

9. 前記印刷方式で用いる印刷版、転写体、基材および圧胴の少なくとも1つが、弾性体であることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

10. 2色以上の発光層形成用塗工液の塗り分けが可能であることを特徴とする請求項1に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

11. 2色以上の発光層形成用塗工液の塗り分けが可能であることを特徴とする請求項2に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

12. 2色以上の前記発光層を印刷方式で形成する際、先に印刷された全ての発光層形成用塗工液が固化した後、塗布部を保護材で覆い、次いで後の発光層形成用塗工液を印刷することを特徴とする請求項10に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

13. 2色以上の前記発光層を印刷方式で形成する際、先に印刷された全ての発光層形成用塗工液が固化した後、塗布部を保護材で覆い、次いで後の発光層形成用塗工液を印刷することを特徴とする請求項11に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

14. 2色以上の前記発光層を印刷方式で形成する際、先に印刷された全ての発光層形成用塗工液が固化する前に後の発光層形成用塗工液を印刷することを特徴とする請求項10に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。

15. 2色以上の前記発光層を印刷方式で形成する際、先に印刷された全ての発光層形成用塗工液が固化する前に後の発光層形成用塗工液を印刷することを特徴とする請求項11に記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。